

## طراحی و شبیه سازی گیت های منطقی گرافن پلازمونیکی مادون قرمز با زیر لایه

### نیترید بور شش گوشه

رحیم برومندی، عباس ظرفیکار و مهدی میری

شیراز. دانشگاه شیراز. دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر. بخش مخابرات و الکترونیک

چکیده - در این مقاله به طراحی و شبیه سازی گیت های گرافن پلازمونیکی  $AND$  و  $OR$  با زیر لایه نیترید بور شش گوشه پرداخته شده است. در این گیت ها پلازمون پلاریتون های سطحی به وسیله موج ورودی با فرکانس  $40\text{THz}$  با پلاریزاسیون  $TM$  در حالتی که پتانسیل شیمیایی نوارهای گرافنی در موجب حدود  $0.3\text{eV}$  تنظیم شده است، تحریک شده اند. استفاده از نیترید بور شش گوشه به جای دی اکسید سیلیکون به عنوان زیر لایه، تلفات کمتر پلازمون پلاریتون های سطحی را نتیجه می کند. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که نسبت تمایز برای گیت های  $AND$  و  $OR$  با زیر لایه دی اکسید سیلیکون به ترتیب برابر  $28\text{dB}$  و  $25\text{dB}$  و تلفات الحاقی برابر  $14\text{dB}$  و  $29\text{dB}$  می باشد در حالی که نسبت تمایز گیت های  $AND$  و  $OR$  پیشنهادی با زیر لایه نیترید بور شش گوشه به ترتیب برابر  $34\text{dB}$  و  $21\text{dB}$  و تلفات الحاقی برابر  $9.7\text{dB}$  و  $4.3\text{dB}$  است. نتایج بدست آمده حاکی از بهبود نسبت تمایز و تلفات الحاقی و در عین حال ابعاد کوچکتر برای گیتهای منطقی مورد نظر است.

کلید واژه- گرافن، پلازمونیک، گیت های منطقی نوری، نیترید بور شش گوشه

## Design and Simulation of Graphene-Based Plasmonic Infrared Logic Gates with Hexagonal Boron Nitride Substrate

Rahim Borumandi, Abbas Zarifkar and Mehdi Miri

Shiraz, Shiraz University, School of Electrical and Computer Engineering, department of Communications and Electronics

Abstract- In this paper, design and simulation of AND and OR graphene plasmonic gates with hexagonal boron nitride substrate is presented. In these gates, surface plasmon polaritons are excited by a  $40\text{THz}$  incoming wave with TM polarization while the chemical potential of graphene strips is tuned about  $0.3\text{eV}$ . Utilizing of thin layers of hexagonal boron nitride instead of silicon dioxide as substrate allows less propagation loss of surface plasmon polaritons. Simulation results show that the extinction ratios for AND and OR gates with silicon dioxide substrate are  $28\text{dB}$  and  $25\text{dB}$  and the insertion losses are  $14\text{dB}$  and  $21\text{dB}$ , respectively, while the extinction ratios of the proposed AND and OR gates with hexagonal boron nitride substrate are  $34\text{dB}$  and  $29\text{dB}$  and the insertion losses are  $9.7\text{dB}$  and  $4.3\text{dB}$ , respectively. Our numerical results show considerable improvement in extinction ratio and insertion loss of the presented logic gates along with the advantage of smaller dimensions.

Keywords: Graphene, plasmonic, optical logic gates, hexagonal boron nitride

## ۱- مقدمه

پلازمونیک به عنوان روشی جهت کارکردن در ابعاد کسری از طول موج و غلبه بر محدودیت تفرق نور<sup>۱</sup> شناخته شده است. اساس ادوات پلازمونیکی انتشار پلازمن پلاریتون های سطحی<sup>۲</sup> بین سطح دیکتریک و فلز می باشد. مدهای سطحی ایجاد شده به وسیله فلزات نجیب مانند طلا و نقره در محدوده نور مولی قرار دارند. برای ایجاد مدهای سطحی با فرکانس کمتر، فلزات نجیب دارای تلفات زیادی می باشند[2]-[1].

از طرفی با کارگیری گرافن که دارای ویژگی های بارزی از جمله تلفات کمتر، محبوس شدگی بیشتر پلازمن پلاریتون های سطحی گرافن<sup>۳</sup> و تنظیم پذیری می باشد، امکان ایجاد مدهای سطحی گرافنی با فرکانس کمتر و کیفیت مورد قبول فراهم می شود. تلفات کمتر در گرافن از سرعت بالای حامل ها در آن ناشی می شود. همچنین تنظیم پذیری مدهای سطحی گرافن ناشی از مقدار موهومی رسانایی گرافن است، که این مقدار موهومی به فرکانس کاری، زمان استراحت حامل و پتانسیل شیمیایی بستگی دارد[5]-[3]. اغلب ویژگی های مطلوب گرافن از جمله محبوس شدگی بیشتر مدهای سطحی گرافن در ادوات پلازمونیکی در صورتی به دست می آیند که لایه گرافن تک لایه مورد استفاده در ادوات پلازمونیکی، بسیار خالص باشد. در عین حال زیرلایه<sup>۴</sup> ی گرافن نقش مهمی در کیفیت ادوات پلازمونیکی دارد. در سال های اخیر به جای استفاده از دی اکسید سیلیکون ( $\text{SiO}_2$ ) که دارای سطحی ناهموار است از عایقی جدید به نام نیترید بور شش گوشه (h-BN)<sup>۵</sup>، به عنوان زیرلایه<sup>۶</sup> ی گرافن در ادوات گرافن پلازمونیکی استفاده می شود. این عایق جدید همانند گرافن دارای ساختار دو بعدی است و از طرفی این عایق خواص نوری بهتری نسبت به دی اکسید سیلیکون دارد [6].

## ۲- تئوری کار

گرافن بر حسب مقدار پتانسیل شیمیایی اش که از طریق بایاس الکتریکی یا آلایش<sup>۷</sup> تغییر می کند، بر طبق فرمول کوبوی می تواند به عنوان عایق یا رسانا عمل کند [7]. برای انتشار مد TM، پتانسیل شیمیایی گرافن (u<sub>c</sub>) باید از مقدار آستانه  $\frac{\bar{h}w}{2}$  بیشتر باشد که در آن W فرکانس زاویه ای و  $\bar{h}$  ثابت پلانک کاهش یافته است [7].

در مرجع [8] گیت گرافن پلازمونیکی با زیرلایه دی اکسید سیلیکون شبیه سازی شده است که فرکانسی کاری آن در ناحیه تراهنتر (6THz) می باشد. برخلاف زیر لایه های متداولی چون دی اکسید سیلیکون برای گرافن که از سطح ناهمواری برخوردار می باشد، نیترید بور شش گوشه دارای سطحی صاف و هموار است. برخلاف مواد سه بعدی متداول همانند دی اکسید سیلیکون، نیترید بور شش گوشه همانند گرافن ماده ای دو بعدی است. خصوصیت دو بعدی بودن نیترید بور شش گوشه به همراه سطح صاف و هموار،<sup>۸</sup> سبب کاهش نرخ پراکندگی حامل ها، افزایش تحرك حامل ها و خواص نوری بهتر در ادوات گرافنی می شود[9]. بنابراین، در این مقاله، گیت های گرافن پلازمونیکی در فرکانس کاری مادون قرمز(40THz) با زیرلایه نیترید بور شش گوشه طراحی و شبیه سازی شده و مشخصات آن با گیت های گرافن پلازمونیکی با زیرلایه دی اکسید سیلیکون مقایسه می شود.

## ۳- طراحی و شبیه سازی

ساختار گیت AND پیشنهادی در شکل ۱ نشان داده شده است. همانطور که در این شکل دیده می شود، گیت AND از یک نوار گرافنی مستطیل شکل که بروی آن دو پنجره کنترلی با الکترودهایی از جنس طلا قرار داده شده، تشکیل شده است. عرض نوار گرافن و پنجره های کنترلی  $W=150\text{nm}$ ، طول نوار گرافنی  $L_1=1200\text{nm}$ ، طول پنجره های کنترلی  $L_2=250\text{nm}$  و ضخامت زیرلایه نیترید بور شش گوشه  $0.3\text{nm}$  است. با اعمال ولتاژ مناسب

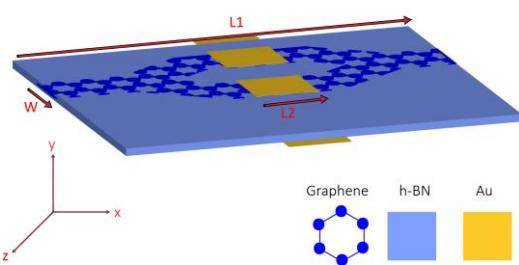
<sup>۱</sup>Light diffraction

<sup>۲</sup>Surface plasmon polaritons

<sup>۳</sup>Graphene surface plasmon polaritons

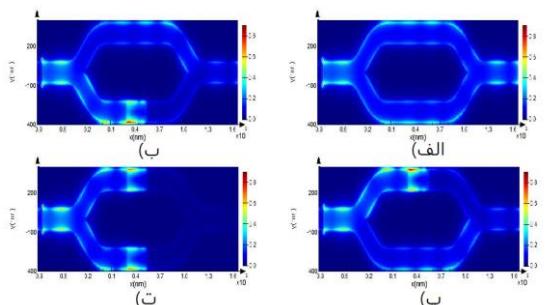
<sup>۴</sup>Hexagonal Boron nitride

W=150nm، طول ماخ-زندر  $L_1=2600\text{nm}$  ، طول پنجره-های کنترلی  $L_2=250\text{nm}$  و ضخامت زیرلایه نیترید بور شش گوشه  $0.3\text{nm}$  می‌باشد. پتانسیل شیمیابی گرافن برای حالت انتشار  $0.03\text{eV}$  و برای حالت قطع  $0.35\text{eV}$  تنظیم شده است. برای حالتی که زیرلایه دی اکسید سیلیکون انتخاب شود، با کاهش ضخامت زیرلایه به  $200\text{nm}$ ، با افزایش شدید تلفات و عدم انتشار مدهای سطحی مواجه خواهیم بود و لذا ضخامت برابر با  $200\text{nm}$  انتخاب شده است.



شکل ۳: گیت OR با زیرلایه نیترید بور شش گوشه، پنجره‌های کنترلی در دو بازوی ماخ-زندر با تغییر پتانسیل شیمیابی نقش کنترل انتشار مدهای سطحی و پیاده سازی منطق OR را ایفا می‌کند.

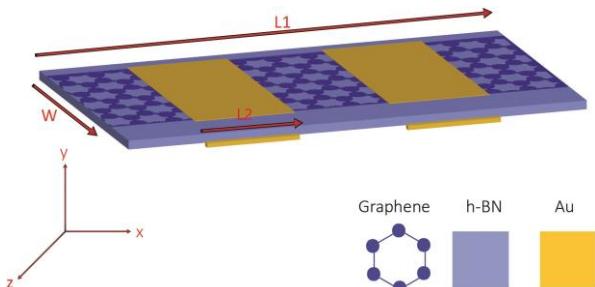
نتایج شبیه سازی برای پروفایل میدان در گیت OR پیشنهادی، در شکل ۴ آمده است.



شکل ۴: پروفایل میدان الکتریکی در حالت‌های مختلف گیت OR (الف) پروفایل میدان گیت در حالت  $(1,1)$  (ب) پروفایل میدان گیت در حالت  $(1,0)$  (پ) پروفایل میدان گیت در حالت  $(0,1)$  (ت) پروفایل میدان گیت در حالت  $(0,0)$ .

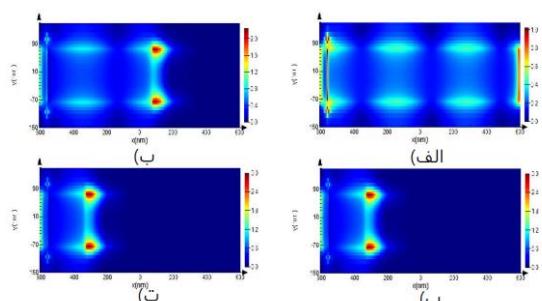
به منظور مقایسه مشخصات گیتهای AND و OR طراحی شده برای دو حالتی که دی اکسید سیلیکون و نیترید بور

به الکترودها، پتانسیل شیمیابی گرافن برای حالت انتشار  $0.03\text{eV}$  و برای حالت قطع  $0.35\text{eV}$  تنظیم شده است.



شکل ۱: گیت AND با زیرلایه نیترید بور شش گوشه، با اعمال ولتاژ از طریق الکترودهای طلا و تغییر پتانسیل شیمیابی انتشار مدهای سطحی گرافن کنترل شده و گیت منطق AND حاصل شده است.

شبیه سازی، با روش تفاضل محدود در حوزه‌ی زمان<sup>۷</sup> انجام شده است. پروفایل میدان الکتریکی در حالات منطقی مختلف برای گیت AND در شکل ۲ نشان داده شده است.



شکل ۲: پروفایل میدان الکتریکی در حالت‌های مختلف گیت AND (الف) پروفایل میدان گیت در حالت  $(1,1)$  (ب) پروفایل میدان گیت در حالت  $(1,0)$  (پ) پروفایل میدان گیت در حالت  $(0,1)$  (ت) پروفایل میدان گیت در حالت  $(0,0)$ .

ساختر گیت OR پیشنهادی در شکل ۳ دیده می‌شود. ساختار گیت OR در واقع مشابه یک تداخلگر ماخ-زندر می‌باشد که با تغییر پتانسیل شیمیابی گرافن از طریق پنجره‌های کنترلی قادر به کنترل انتشار مدهای سطحی خواهیم بود. در واقع اعمال بایاس الکتریکی به منزله‌ی منطق یک و عدم بایاس الکتریکی بیانگر منطق صفر می‌باشد. عرض نوار گرافنی و پنجره‌های کنترلی

<sup>۷</sup> Finite-Difference Time-Domain

#### ۴- جمع بندی

بنابراین، استفاده از نیترید بور شش گوشه نه تنها تلفات کمتر و نسبت تمایز بهتری را رقم می‌زند بلکه به دلیل ابعاد کوچکتر، از نظر فشرده‌سازی ادوات پلازمونیکی بسیار مناسبتر خواهد بود، تا جایی که می‌توان گیت‌های منطقی طراحی شده را در زمرة گیت‌های گرافن پلازمونیکی دو بعدی در نظر گرفت.

#### مراجع

- [1] J.-S. Gómez-Díaz and J. Perruisseau-Carrier, "Graphene based plasmonic switches at nearinfrared frequencies," *Optics express*, vol. 21, pp. 15490-15504, 2013.
- [2] C.-H. Hsieh, K.-P. Lin, and K.-C. Leou, "Design of a Compact High-Performance ElectroOptic Plasmonic Switch," *IEEE Photonics Technology Letters*, vol. 27, pp.2473-2476,2015.
- [3] Q. Bao and K. P. Loh, "Graphene photonics, plasmonics, and broadband optoelectronic devices," *ACS nano*, vol. 6, pp.3677-3694,2012.
- [4] A. Farmani, M. Miri, and M. H. Sheikhi, "Tunable resonant Goos-Hänchen and Imbert-Fedorov shifts in total reflection of terahertz beams from graphene plasmonic metasurfaces," *JOSA B*, vol. 34, pp. 1097-1106, 2017.
- [5] K. Jamalpoor, A. Zarifkar, and M. Miri, "Application of graphene second-order nonlinearity in THz plasmons excitation," *Photonics and Nanostructures-Fundamentals and Applications*,2017.
- [6] K. S. Novoselov, V. Fal, L. Colombo, P. Gellert, M. Schwab, and K. Kim, "A roadmap for graphene," *nature*, vol. 490, pp. 192-200, 2012.
- [7] D. A. Kuzmin, I. V. Bychkov, V. G. Shavrov, and L. N. Kotov, "Transverse-electric plasmonic modes of cylindrical graphene-based waveguide at near-infrared and visible frequencies," *Scientific Reports*, vol. 6, no. 1, 2016.
- [8] M. Yarahmadi, M. K. Moravvej-Farshi, and L. Yousefi, "Subwavelength graphene-based plasmonic THz switches and logic gates," *IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology*, vol. 5, pp. 725-731, 2015.
- [9] E. Kan, H. Ren, F. Wu, Z. Li, R. Lu, C. Xiao, et al., "Why the band gap of graphene is tunable on hexagonal boron nitride," *The Journal of Physical Chemistry C*, vol. 116,pp.3142-3146, 2012.

شش گوشه به عنوان زیرلایه انتخاب شوند، نتایج شبیه سازی برای نسبت تمایز<sup>۸</sup>(نسبت توان خروجی گیت‌های منطقی در حالت ارزش منطقی یک به توان خروجی در حالت ارزش منطقی صفر بر حسب واحد دسیبل)، تلفات الحاقی<sup>۹</sup>(کاهش توان سیگنال نوری ورودی کوپل شده در عبور از گیت‌های منطقی بر حسب واحد دسیبل) و تلفات مد پایه(تلفات مدهای حل شده بر حسب واحد دسیبل بر سانتی متر در نرم افزار لومریکال) در جدول ۱ ارائه شده است.

جدول ۱: مقایسه بین گیت‌های منطقی با زیرلایه‌های مختلف

نوع گیت	زیرلایه	نسبت تمایز	تلفات الحاقی	تلفات مد پایه
AND	SiO <sub>2</sub>	28dB	14dB	10534dB/cm
OR	SiO <sub>2</sub>	25dB	21dB	14165dB/cm
AND	h-BN	34dB	9.7dB	10204dB/cm
OR	h-BN	29dB	4.3dB	13960dB/cm

همان طور که در این جدول مشاهده می‌شود، استفاده از نیترید بور شش گوشه باعث کاهش تلفات الحاقی و بهبود قابل توجه نسبت تمایز شده است که دلیل آن را می‌توان خواص نوری بهتر نیترید بور شش گوشه نسبت به دی-اکسید سیلیکون دانست. از سوی دیگر، برای حالتی که دی-اکسید سیلیکون به عنوان زیرلایه انتخاب شده است، ضخامت زیرلایه را نمی‌توان کمتر از 200nm انتخاب کرد زیرا تلفات مدهای سطحی بسیار زیاد شده و طول انتشار آنها بسیار کاهش می‌یابد تا جایی که مد پلازمونیکی در گیت‌ها منتشر نخواهد گشت. اما با انتخاب نیترید بور شش گوشه به عنوان زیرلایه ، با ضخامت 0.3nm ، تلفات کمی برای مدهای سطحی حاصل می‌شود.

<sup>۸</sup>Extinction ratio

<sup>۹</sup>Decibel

<sup>۱</sup>Insertion loss